短波碲镉汞光伏器件的低频噪声研究

黄杨程¹²⁾ 刘大福¹²⁾ 梁晋穗¹²⁾ 龚海梅¹⁾

1(中国科学院上海技术物理研究所传感技术国家重点实验室,上海 200083)

²(中国科学院研究生院,北京 100039)

(2004年6月8日收到;2004年8月30日收到修改稿)

对所研制的短波光伏碲镉汞器件进行了变温电流-电压特性和低频噪声研究,测试温度范围 255—293K. 实验 结果表明随着温度的下降,器件的优值因子 $R_0 A \downarrow 4.5 \times 10^3 \Omega \text{ cm}^2$ 增加到 $7 \times 10^4 \Omega \text{ cm}^2$.器件在低频区的主要噪声成 分是 1/f 噪声和产生-复合噪声,在高频区主要是散粒噪声.在测试的偏压内,器件的 1/f 噪声功率谱密度与流过器 件的电流的平方成正比,器件的 Hooge 系数为 3×10^{-4} — 7×10^{-4} . 从噪声功率谱密度曲线分析中得到产生-复合噪 声的特征时间常数 τ .通过 τ 的温度特性得到了器件的深能级.

关键词:碲镉汞,优值因子,低频噪声,深能级 PACC:7280E,7270,7155

1.引 言

碲镉汞三元系化合物半导体是一种优良的红外 探测器材料,具有介电常数小、光学吸收系数大、载 流子迁移率高等特点,特别是由于其禁带宽度随组 分的变化连续可调,因此可用来制备各种响应波段 的红外探测器¹¹.目前在卫星、遥感、夜视及红外制 导等领域,由碲镉汞制备的红外探测器有着广泛的 应用.

由于红外探测器的工作频率较低,因此器件的 低频噪声是限制器件探测水平的关键因素之一,而 且低频噪声能敏感地反映器件的许多潜在缺陷,其 测量和分析已成为半导体器件质量表征和可靠性评 估的一种新手段²¹,因此研究红外探测器的低频噪 声具有重要的意义.

当前碲镉汞器件的研制一方面沿长线列、焦平 面等大规模方向发展,另一方面器件的响应波长也 沿着甚短波和甚长波的方向发展.特别是在 1—2µm 的波长范围,由于很多物质在该波段具有独特的光 谱特性,因此在空间对地探测,如了解资源分布、土 壤水分监测、大气成分分析、农作物估产等方面,短 波红外探测器有着广泛的需求.本文研究了我所研 制的短波碲镉汞光伏探测器的变温电流-电压特性 和低频噪声特性,估算了温度对器件探测率的影响, 并根据器件的低频噪声观察到器件中的一个深能级 缺陷.

2. 理论模型

2.1. 优值因子 R₀A

一般受热噪声限制的光伏型红外探测器的电流-电压特性可以近似地写为^[3]

$$I = I_0 \left(\exp\left(\frac{qV}{nk_{\rm B}T}\right) - 1 \right) , \qquad (1)$$

其中 V 为外加电压, q 代表电子电荷, k_{B} 为 Boltzmann 常数, T 是器件温度, I_{0} 是反向饱和电流, n 称为理想因子, 当器件由扩散电流限制时n = 1, 由产生-复合电流限制时n = 2, 当器件由两种电流 机理共同影响时, n = 1—2. 器件的零偏电阻为

$$R_0 = \left(\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}V}\right)^{-1} \bigg|_{V=0} , \qquad (2)$$

可通过对电流-电压曲线进行微分求得.

光伏型红外探测器的探测率为[3]

$$D_{\lambda}^{*} = \frac{q\eta\lambda}{hc} \sqrt{\frac{R_{0}A}{4kT}} , \qquad (3)$$

其中 η 为量子效率 ,A 为光敏元面积 ,其他符号具 有常用的含义 ,R₀A 通常称为光伏型探测器的优值 因子 ,是表征光伏型探测器性能的一个重要指标 ,由 器件的零偏电阻乘以光敏元面积得到.

对于室温附近工作的n⁺-on-p碲镉汞光伏器

件 ,主要考虑基区的扩散电流和空间电荷区的产生-复合电流作用 ,其优值因子与温度的关系可表示 为^[3]

$$R_0 A \propto \exp(E_s/nkT).$$
 (4)

因此通过对器件进行变温电流-电压特性测试,由电 流-电压特性得到器件的优值因子 R₀A 根据(3)式, 可以估算温度对器件探测性能的影响,由(4)式得到 理想因子 n,可以分析限制器件性能的电流机理.

2.2. 低频噪声

光伏探测器的噪声主要包括 1/f 噪声、产生-复 合噪声和散粒噪声^[2].

1/f 噪声的基本特征是其功率谱密度与频率成 反比 其基本表达式为

$$S_{I}(f) = AI^{\beta}/f^{\gamma} , \qquad (5)$$

其中 *I* 为通过器件的电流 ;*f* 为频率 ;常数 $\gamma = 0.8$ — 1.2 典型值为 1.0 ;对于均匀材料 $\beta = 2.0$,对于结构 较复杂的器件 $\beta = 1.0$ —2.0.在低频区 ,1/*f* 噪声是 光电探测器的主要噪声表现形式 . Hooge^[4]根据迁移 率涨落模型给出了一个经验公式 ,即

$$S_{I}(f) = \alpha_{\rm H} I^{2} / f N$$
, (6)

其中 N 为载流子数 , $\alpha_{\rm H}$ 是 Hooge 系数.载流子数由 Van Der Ziel^{{5]}提出的方法

$$N = It/q$$
 (7)
来确定 其中 t 为载流子的渡越时间. Hooge 系数 $\alpha_{\rm H}$
可作为衡量器件 $1/f$ 噪声水平的一个参数.

产生-复合噪声主要来源于禁带中部附近的深 能级产生-复合中心和陷阱中心,其表达式为

$$S_{I}(f) = \sum_{i=1}^{m} \frac{C_{i}\tau_{i}}{1 + (2\pi f\tau_{i})^{2}}, \qquad (8)$$

其中 m 代表深能级的个数,这里 τ 为产生 复合噪声的特征时间常数,对于 p 型材料

 $\frac{1}{\tau} = \sigma_{\rm p} v_{\rm th} n \{1 + B \exp[(E_{\rm F} - E_{\rm t})/kT]\}, (9)$

 $n = N_v \exp[-(E_F - E_v)/kT],$ (10) 其中 σ_p 是空穴俘获截面 , v_{th} 是空穴的平均热速度 , N_v 是价带有效态密度 , E_v 是价带顶能量 , E_t 是陷 阱能量.由于 v_{th} 随 $T^{1/2}$ 变化 , N_v 有 $T^{3/2}$ 关系 ,所以 τ 的温度特性可以表示为

 $\frac{1}{\tau} = DT^2 \exp[-(E_1 - E_y)kT], \quad (11)$ 式中 D 是一个与温度无关的系数.这样,由 h(τT^2)-1/T曲线的斜率即可得到激活能 $\Delta E = E_1 -$ $E_{\rm v}$.

散粒噪声是白噪声 ,与频率无关 ,其直接起源于 电子的粒子性 ,表达式为

$$S_f(f) = 2qI. \tag{12}$$

由实验测得的噪声谱是多种噪声的叠加,总的 功率谱密度可表示为

$$S_{i}(f) = A + \frac{B}{f} + \sum_{i=1}^{m} \frac{C_{i}\tau_{i}}{1 + (2\pi f\tau_{i})^{2}}, \quad (13)$$

式中 ,A ,B ,C_i 分别为散粒噪声分量、1/f 噪声分量、 时间常数为 τ_i 的产生-复合噪声分量的幅度.在许 多情况下 ,尤其是频率较低时 ,产生-复合噪声与 1/f噪声叠加在一起 ,表现为 1/f 曲线上的凸起或驼峰 , 为了精确测定产生-复合噪声的转折频率 ,通常将常 规噪声功率谱 S(f) 转换为 fS(f)谱来处理 ,即

$$fS(f) = Af + B + \sum_{i=1}^{m} \frac{C_i f \tau_i}{1 + (2\pi f \tau_i)^2}.$$
 (14)

由 fS(f) 谱的峰值位置可较精确地确定产生-复合 噪声的特征时间常数.

3.实验

实验采用的 n⁺-on-p 碲镉汞光伏器件是以改进 的固体区溶法生长的组分 x = 0.6 的 $H_{g_{1-x}}Cd_x$ Te 晶 体作为 p 型衬底材料 ,经过抛光、腐蚀、钝化等一系 列表面处理工艺后 ,采用 B 离子注入形成 n 型区 ,再 经过电极制备及划片封装等工艺制成 .

对制作好的器件进行变温电流-电压测试 温度 范围 255—293K 测试采用微机控制下的 Keithlev236 型可编程电流-电压测试仪完成,在器件的基座上贴 有铂电阻 用来监测器件的实际温度 器件的低频噪 声测 试 是 在 安 捷 伦 公 司 的 动 态 信 号 分 析 仪 HP35670A 上进行的,该仪器可以直接进行 FFT 分 析.测试时先对器件进行有效的屏蔽 尽量减少外界 因素的干扰,然后给器件加上一定的偏压,噪声信号 通过低噪声电流前置放大器送到信号分析仪上进行 处理.低噪声电流前置放大器采用的是美国 DL Instruments 公司的高速低噪声互阻抗前置电流放大 器 DL1211,可以给输入端提供 ± 15V 的偏压,首先 在室温下测试了不同偏压下器件的低频噪声 ;然后 在 – 100mV 固定偏压下,测试了不同温度下器件的 低频噪声,所有测量均在避光和电屏蔽的条件下进 行的.具体的测试装置如图2所示.



图 1 电流-电压特性及低频噪声测试系统

4. 实验结果与讨论

4.1. 优值因子 R₀A

一般的短波光伏器件工作于室温,无需制冷,但 随着对探测器性能要求的不断提高,室温工作的器 件的性能逐渐难以满足要求,适当的低温能减小器 件的暗电流,提高器件的性能.半导体致冷器具有体 积小,功耗低,使用方便的优点,因此在半导体致冷 温度范围内研究短波光伏器件性能与温度的关系具 有重要意义.

图 2 是器件的优值因子 R_0A 与温度的关系.图 中点是实验所得数据,测试温度范围 255—293K,实 线是拟合得到的结果 $R_0A = 1120\exp(5150/T)$.根据 (4)式可知器件在这温度范围内的理想因子 n 约为 1.6,因此在这一温度范围内器件是由扩散电流和产 生-复合电流机理共同限制的,而且产生-复合电流 机理所起的作用更大.随着温度的下降,器件的优值 因子由 $4.5 \times 10^3 \Omega cm^2$ 增加到 $7 \times 10^4 \Omega cm^2$,由(3)式 可知器件的探测率提高了 4 倍.

4.2. 低频噪声

图 3 是在室温下测试的不同偏压下器件的低频 噪声功率谱.在较低偏压下,器件的噪声成分主要是 1/f 噪声和散粒噪声,随着偏压的增大,器件的噪声 随之增大,而且产生-复合噪声成分也逐渐增大,在 噪声功率谱上表现为曲线出现突起或驼峰,在低频 区,噪声成分主要是1/f 噪声和产生-复合噪声.图4



图 2 优值因子 R₀A 与温度的关系

是室温时器件反向偏压下的电流 - 电压特性 · 室温时器件的暗电流成分主要是扩散电流和产生 - 复合电流 ,在小偏压下 ,产生 - 复合电流较小 ,随着偏压的增大 ,耗尽区的宽度随电压的平方根成比例的增大 ,产生 - 复合电流也随之增大 ,图 4 给出的两种电流成分随偏压变化的拟合结果表明 ,产生 - 复合电流逐渐占据主导地位 ,在噪声功率谱上表现为曲线出现突起 ,且成分逐渐增大.

图 5 是频率为 16Hz 时 器件的暗电流与噪声功 率的关系,根据 Hooge 的经验公式,器件的 1/f 噪声 功率与流过器件的电流的平方成正比 图 5 表明我 们所研制的器件的噪声特性符合 Hooge 经验关系, 由(6)和(7)式 取 $t = 10^{-7}$ s,得到器件的 Hooge 系数 为 $(3-7) \times 10^{-4}$,与国外同行给出的结果在同一数 量级 说明目前研制的器件具有较好的低频噪声特 性.对于 1/f 噪声来源的研究,主要有迁移率涨落模 型和表面载流子数涨落模型 前者主要是体效应 后 者主要是表面效应,不同的研究者在对碲镉汞光伏 器件的研究过程中给出不同的结论.Tobin^[6]在研究 碲镉汞光伏器件的噪声时发现 1/f 噪声与光电流及 扩散电流无关,但与表面复合电流成比例,Bajaf^{7]}在 研究液相外延制备的碲镉汞光伏器件时认为 1/f 噪 声起源于体内的耗尽区 ,与器件的表面状况关系不 大.Beck^[8]在研究金属与碲镉汞的欧姆接触时也观 察到 1/f 噪声.van der Ziel^{5]}根据已经得到的理论和 实验结果,把器件中的 1/f 噪声分为基本 1/f 噪声与 非基本 1/f 噪声.其中位于空间电荷区、表面氧化层 等处的陷阱中心对载流子的随机俘获与发射 引起 载流子数涨落而产生的 1/f 噪声从本质上可以完全

消除 称为非基本 1/f 噪声.而各种散射过程的随机 性引起的迁移率涨落而产生的 1/f 噪声从本质上看 是不能消除的,故称为基本 1/f 噪声,实验观测到的 是两种噪声机理的共同结果.本文测试结果表明我 们研制的器件的 1/f 噪声与扩散电流及产生-复合 电流都有关系,与 Wu^[9]和 van der Ziel 给出的结论一 致,说明目前的器件工艺还不能将非基本 1/f 噪声 降低到可以忽略的程度.这可能是由于离子注入成 结中注入离子与碲镉汞相互作用引入的晶格缺陷和 器件表面的缺陷引起载流子的涨落.



图 3 室温时不同偏压下器件的低频噪声功率谱



图 4 室温时器件的反偏暗电流

碲镉汞中深能级缺陷¹⁰¹一直都受到人们的广 泛关注,它是影响器件性能的一个主要的限制因素. 由于深能级关系到短程势而不能用有效质量理论来 描述,其缺陷密度也较低,从而使其检测非常困 难¹¹⁻¹³¹特别是在窄禁带半导体碲镉汞材料中.研 究深能级缺陷的方法主要有深能级瞬态谱(DLTS) 导纳谱(AS)和热激电流(TSC)等方法,但这些方法 都需要比较复杂的理论和昂贵的仪器.由于产生-复



图 5 器件噪声功率与暗电流的关系

合噪声主要来源于禁带中部附近的深能级产生-复 合中心和陷阱中心,因此通过研究器件的噪声特性 也能得到器件的深能级.而且与其他方法相比,噪声 测试更为容易,所需实验设备也简单,对于只需知道 深能级杂质的能级或激活能的时候,采用这种方法 最为有效.

图 6 是器件的典型 fS(f)谱,由谱的峰值位置 可以较为精确的确定产生-复合噪声的特征时间常 数 $\tau = 1/2\pi f$.表 1 是根据不同温度的低频噪声谱得 到的温度与特征频率的关系.根据表 1 的数据对 ln(τT^2)-1/T作图,见图 7,得到缺陷激活能 $\Delta E =$ 0.475eV.一般认为碲镉汞中的深能级中心按激活能 可分为三类.一种是钉扎在禁带中央附近 1/2 E_g 处, 另外两种就是在 1/4 E_g 和 3/4 E_g 处,它们的起源还 不是很清楚.对于实验所用的器件,其截止波长在 1.7 μ m,对应的禁带宽度约为 0.7eV,由噪声实验得 到的深能级可认为是属于 3/4 E_g .胡新文^[14]在利用 导纳谱研究短波碲镉汞光伏器件深能级时测得缺陷 激活能为 0.15eV,认为该深能级属于 1/4 E_g .在某些



图 6 器件的典型 fS(f)谱

器件中也观察到 3/4E。 缺陷. 与胡新文给出的结果 相比 本文结果只给出一个缺陷能级 可能与实验温 度不够低或所采用的器件质量有关.



由产生-复合噪声特征时间常数与温度关系得到的缺陷激 图 7 活能

- [1] Willardson R K et al 1981 Semiconductors and Semimetals 18 (New York : Academic) p1
- [2] Scholz F et al 1988 Solid-State Electronics 31 205
- Tang D Y et al 1989 Introduction of Photoelectric Device (Shanghai : [3] Shanghai Science and Technology Literature Publish Company) p320 (in Chinese]汤定元等 1989 光电器件概论(上海:上海科技 文献出版社)第320页]
- [4] Hooge F N 1969 Phys. Lett. A 29 139
- [5] Van der Ziel 1988 Proc. IEEE. 16 233
- [6] Tobin S P et al 1980 IEEE Transactions on Electron Devices ED-27 43
- [7] Bajaj J et al 1985 J. Vac. Sci. Technol. A 3 192
- [8] Beck W A et al 1990 J. Appl. Phys. 67 6340

	衣 1 温加	设与广生-	复百喋户	特征则平	的大杀	
昌度/K	259	264	274	279	284	292
z -						

湄 频率/Hz 60 149 252 416 688 940

- *.*.

5.结 论

对短波碲镉汞光伏器件进行了变温电流-电压 特性和低频噪声研究 得到以下结论.

1. 随着温度从 293K 降到 255K ,器件的优值因 子 $R_0 A$ 值从 $4.5 \times 10^3 \Omega \text{ cm}^2$ 增加到 $7 \times 10^4 \Omega \text{ cm}^2$.

2. 器件在低频区的主要噪声成分是 1/f 噪声和 产生-复合噪声,在高频区主要是散粒噪声,器件的 Hooge 系数为(3-7)×10⁻⁴.

3. 由器件的噪声功率谱密度曲线分析中得到 器件的一个深能级,其激活能为 0.475eV,认为该深 能级属于 3/4E_.

- [9] Wu X L et al 1987 IEEE Transactions on Electron Devices , ED-34 1971
- [10] Li Y et al 2000 Acta Phys. Sin. 49 132 (in Chinese) [李 毅等 2000 物理学报 49 132]
- [11] Xiao X F et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 138(in Chinese)[肖细凤 等 2002 物理学报 51 138]
- [12] Lu L W et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 372 (in Chinese)[卢励吾 等 2002 物理学报 51 372]
- [13] Xu L et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 877 (in Chinese) [徐 岭等 2002 物理学报 51 877]
- [14] Hu X W et al 1999 Acta Phys. Sin. 48 1107 (in Chinese) [胡新 文等 1999 物理学报 48 1107]

Low frequency noise study on short wavelength HgCdTe photodiodes

Huang Yang-Cheng^{1 \mathcal{V}}) Liu Da-Fu^{1 \mathcal{V}}) Liang Jin-Sui^{1 \mathcal{V}}) Gong Hai-Mei^{1)}

 1 (State Key Laboratory of Transducer Technology , Shanghai Institute of Technical Physics ,

Chinese Academy of Sciences , Shanghai 200083 , China)

 $^{2}\$ Graduate School of the Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100039 ,China)

(Received 8 June 2004 ; revised manuscript received 30 August 2004)

Abstract

The current-voltage characteristics and the low frequency noise measured at 255—293K are reported. The figures of merit increase from 4.5×10^3 to $7 \times 10^4 \Omega \text{cm}^2$ as the temperatures decreases. At low frequencies the noise mainly consists of flicker noise and generation recombination (g-r) noise, while at high frequencies thermal noise is the dominant component. The flicker noise current is proportional to the detector current at reverse bias, and the Hooge parameter α_H of the device is $(3-7) \times 10^{-4}$. In addition, the fluctuation time constant τ of the g-r noise is extracted by fitting the curve of the low-frequency noise. Therefore, the trap thermal activation energy of the deep level is obtained from the relation between τ and temperature.

Keywords: HgCdTe, figure of merit, low frequency noise, deep level PACC: 7280E, 7270, 7155